

# GL8 MLA Gen2

## 200mm WLO工艺

## 紫外纳米压印光刻设备

## 晶圆级光学器件加工 (WLO)

### 设备简介

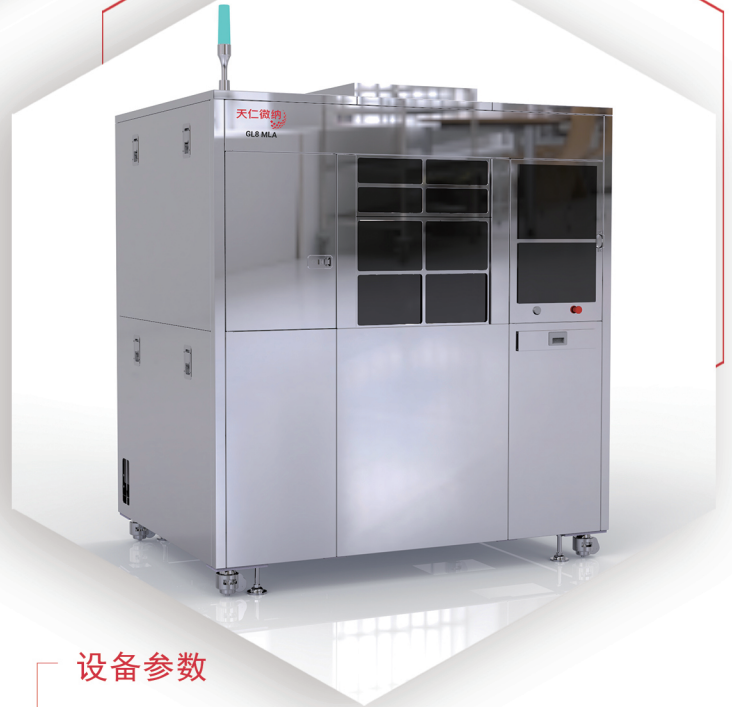
GL8 MLA Gen2是一种专门为晶圆级光学加工 (WLO-Wafer Level Optics) 开发的全幅紫外纳米压印设备, 可在200mm基底面积上平行复制生产聚合物光学器件。

该设备支持从晶圆级母模具表面自动复制柔性复合工作模具, 工作模具具有精度高, 寿命长等特点, 可以显著降低大面积纳米压印工艺中模具使用成本。内置的高精度自动点胶系统、APC (主动模具基底平行控制) 技术, 以及自动脱模功能都保证了大面积晶圆级光学生产的精度、均匀性 (TTV) 与良率。同时, 自动模具基底对位系统还可实现晶圆之间对位堆叠工艺 (WLS-Wafer Level Stacking)。

GL8 MLA Gen2纳米压印设备适用于DOE、匀光片 (Diffuser)、微透镜阵列、菲涅尔透镜等产品的研发和量产。

### 主要功能

- 经过量产验证的200mm晶圆级光学生产 (WLO) 设备
- APC主动模具基底平行控制技术, 确保大面积晶圆压印TTV均匀性
- 设备内自动复制柔性复合工作模具, 降低大面积纳米压印模具使用成本  
内置自动点胶功能
- 自动对位、自动压印、自动曝光固化、自动脱模, 工艺过程无需人工干预
- 标配高功率紫外LED面光源 (365nm, 光强>1000mW/cm<sup>2</sup>), 水冷冷却, 特殊功率以及特殊、混合波长光源可订制, 完美支持各种商用纳米压印材料
- 标配设备内部洁净环境与除静电装置
- 随机提供全套纳米压印工艺与材料, 包括标准示范WLO等工艺流程, 帮助客户零门槛达到国际领先的纳米压印水平



### 设备参数

兼容基底尺寸	2inch、100mm、150mm、200mm 特殊尺寸可定制
支持基底材料	硅片、玻璃、石英、塑料、金属等
上下片方式	手动上下片
晶圆预对位	机械夹持预对位, 可选装光学巡边预对位
纳米压印技术	APC主动平行控制技术, 适合大面积WLO、WLS等工艺
压印精度	优于10纳米*
结构深宽比	优于10比1*
TTV控制	微米级精度 (200mm晶圆)
紫外固化光源	紫外LED (365nm) 面光源, 光强>1000mW/cm <sup>2</sup>
	水冷冷却 (2000mW/cm <sup>2</sup> 类型光源可选配)
设备内部环境	标配, 外部环境Class 100
控制	内部环境优于Class 10*
自动压印	支持
自动脱模	支持
自动工作模具	支持
复制	
模具基底对位	自动对位 (选配)
功能	

\*参数取决于模具、材料、工艺和使用环境, 非设备极限

\*天仁微纳保留对信息的解释权

#### 联系方式

青岛天仁微纳科技有限责任公司

青岛市城阳区祥阳路106号 青岛未来科技产业园6号楼

电话: 0532-67769322

传真: 0532-67768286

电子邮件: [contact@germanlitho.com](mailto:contact@germanlitho.com)

网址: [www.germanlitho.com](http://www.germanlitho.com)

OUR CONTACT!

GermanLitho GmbH

Göttschlag 6b

85391 Allershausen Germany

Tel: +49 (0) 8166 6999069

Fax: +49 (0) 8166 9987619

E-mail: [contact@germanlitho.com](mailto:contact@germanlitho.com)